



제25회 한국반도체학술대회

The 25th Korean Conference on Semiconductors

2018년 2월 5일(월)-7일(수), 강원도 하이원리조트 컨벤션 호텔

2018년 2월 6일(화), 09:00-10:45

Room K (육백II, 6층)

Q. Metrology, Inspection, and Yield Enhancement 분과

[TK1-Q] Metrology & Inspection

좌장: 김진승 교수(전북대학교), 박병천(한국표준과학연구원)

TK1-Q-1 09:00-09:15	TSOM Image Measurement with Iterative MSD Computations Youngback Kim, Junhee Jeong, Joonghee Cho <i>Department of Embedded Systems Engineering, Incheon National University</i>
TK1-Q-2 09:15-09:45	[초청] MI Tech vs Litho Tech Byoung Ho Lee <i>SK Hynix</i>
TK1-Q-3 09:45-10:15	[초청] Next Generation Automated Industrial AFM and Its Applications in Semiconductor Technology Byoung-Woon Ahn, Ahjin Jo, Seong-Hun Yun, Ju Suk Lee, Tae-Gon Kim, Sang-Joon Cho <i>R&D Department, Park Systems Corp.</i>
TK1-Q-4 10:15-10:30	Development of Novel EUV Actinic I nspection Technique : EUV Scanning Lensless Imaging (ESLI) 우동곤 ¹ , 김영웅 ¹ , 김정환 ¹ , 신승혁 ² , 김희울 ² , 안진호 ^{1,3} <i>¹한양대학교 신소재공학과, ²한양대학교 전자컴퓨터통신 공학과, ³나노과학기술연구소</i>
TK1-Q-5 10:30-10:45	반도체 제조산업의 기술 한계 극복을 위한 진단센서 기반의 플라즈마 공정 및 오염입자 발생 측정연구 송제범 ^{1,2} , 이승수 ¹ , 김민중 ¹ , 소종호 ¹ , 오성근 ² , 정낙관 ¹ , 김진태 ¹ , 윤주영 ¹ <i>¹한국표준과학연구원, ²한양대학교</i>